

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第1部門第2区分
【発行日】平成17年3月3日(2005.3.3)

【公表番号】特表2004-524865(P2004-524865A)
【公表日】平成16年8月19日(2004.8.19)
【年通号数】公開・登録公報2004-032
【出願番号】特願2002-516979(P2002-516979)
【国際特許分類第7版】

A 6 1 B 19/00

A 6 1 B 8/12

A 6 1 B 17/42

A 6 1 B 18/12

【F I】

A 6 1 B 19/00 5 0 2

A 6 1 B 8/12

A 6 1 B 17/42

A 6 1 B 17/39 3 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成15年4月3日(2003.4.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

骨盤腫瘍を処置するためのシステムであって、
骨盤部位中に挿入するために適合されたアブレーション装置と、
前記アブレーション装置の末端部に配置された少なくとも1つの熱センサーと、
アブレーション温度を65℃より高く維持するように前記装置に電力を供給するために前記センサーに敏感である制御装置とを有することを特徴とする方法。

【請求項2】

前記アブレーション装置が更に、
展開されるとアブレーションボリュームを画定する展開可能な複数のアームを有することを特徴とする請求項1に記載のシステム。

【請求項3】

少なくとも1つの前記センサーが、複数の展開可能な前記アームのうちの少なくとも1つの末端部に配置されることを特徴とする請求項2に記載のシステム。

【請求項4】

更に、患者と接触するように適合された分散型電極を有することを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のシステム。

【請求項5】

前記アブレーション装置を視覚的に配置するための腹腔鏡を有することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のシステム。

【請求項6】

前記システムが、前記腫瘍に関する前記装置の位置を見るためにイメージングデバイスを利用できるように適合されていることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載のシステム。

【請求項 7】

前記イメージングデバイスが、超音波機器、MRI機器、及びCTデバイスから選択されることを特徴とする請求項 6 に記載のシステム。

【請求項 8】

更に、前記装置にRFエネルギーを送込むために、前記アブレーション装置に機能的に接続されたRFエネルギー源を有することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 9】

前記制御装置が、アブレーション温度を65°C乃至100°Cに維持することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 8 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 10】

前記制御装置が、アブレーション温度を85°C乃至100°Cに維持することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 9 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 11】

前記制御装置が、アブレーションを少なくとも7分間、維持することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 10 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 12】

前記制御装置が、アブレーションを7分乃至14分の間、維持することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 11 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 13】

更に、腹部に炭酸ガスを吹込むためのガス注入装置を有することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 12 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 14】

少なくとも1つの前記センサーのうちの少なくとも1つが熱電対であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 13 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 15】

少なくとも1つの前記センサーのうちの少なくとも1つがインピーダンスを決定するように適合されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 14 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 16】

組織をアブレーションするために用いられることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 15 のいずれかに記載のシステム。

【請求項 17】

骨盤腫瘍を処置するための方法であって、
骨盤腫瘍の近位の骨盤部位中にアブレーション装置を配置するステップと、
少なくとも1つの(i)腹腔鏡若しくは(ii)イメージングデバイスを用いて前記アブレーション装置の位置を確認するステップと、
前記アブレーション装置の前記末端部に配置された少なくとも1つのセンサーを用いて組織の温度をモニターするステップと、
前記腫瘍をアブレーションするために前記骨盤腫瘍に前記アブレーション装置からエネルギーを送込むステップと、
アブレーション温度を65°Cより高い温度に維持するステップとを有することを特徴とする方法。

【請求項 18】

前記維持ステップが、アブレーション温度を65°C乃至100°Cに維持することを特徴とする請求項 17 に記載の方法。

【請求項 19】

前記維持ステップが、アブレーション温度を85°C乃至100°Cに維持することを特徴とする請求項 17 に記載の方法。

【請求項 20】

前記アブレーション装置が複数の展開可能なアームを含んでおり、
前記配置ステップが更に、前記展開可能アームを前記腫瘍の近位に配置するステップを有することを特徴とする請求項 17 乃至請求項 19 のいずれかに記載の方法。

【請求項 21】

前記エネルギー送込みステップが、RFエネルギーを送込むステップを有することを特徴とする請求項 17 乃至請求項 20 のいずれかに記載の方法。

【請求項 22】

更に、前記配置ステップ後の任意の時点で、前記骨盤腫瘍を含む子宮を、前記アブレーション装置に関して再配置するステップを有することを特徴とする請求項 17 乃至請求項 21 のいずれかに記載の方法。

【請求項 23】

更に、前記アブレーション装置の前記軌跡を焼灼するべく前記装置が引き出されるように、前記アブレーション装置からエネルギーを送込むステップを有することを特徴とする請求項 17 乃至請求項 22 のいずれかに記載の方法。

【請求項 24】

更に、前記送込みステップの後に少なくとも第2腫瘍の近位に前記アブレーション装置を再配置するステップと、前記確認ステップ及び前記送込みステップを繰返すステップを有することを特徴とする請求項 17 乃至請求項 23 のいずれかに記載の方法。